



**NAR Labs** 國家實驗研究院

**台灣半導體研究中心**

Taiwan Semiconductor Research Institute

# 晶粒等級圖案定義對準系統 簡介

儀器編號：CF-L20  
廠牌：EVG  
型號：6200NT

## 系統功能

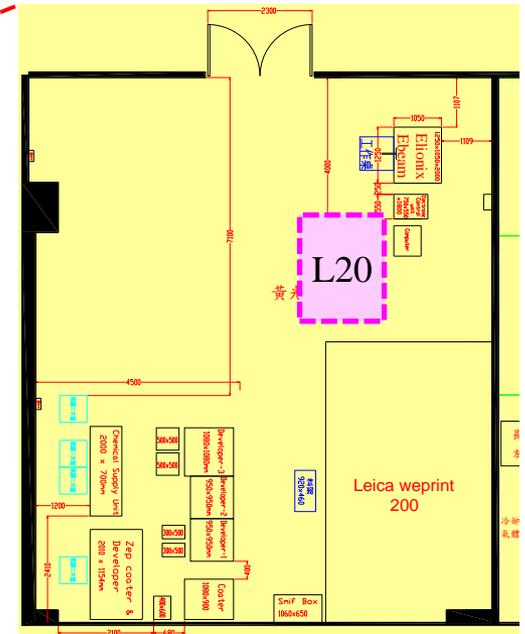


晶粒等級圖案定義對準系統可執行12、25、40、50mm晶方單面對準曝光作業，及4、6、8吋晶圓單面/雙面對準曝光作業，主要功能如下：

曝光模式	Vacuum/Hard/Soft contact Proximity
曝光光源	Broad band(g+h+i) i-line
圖案比例	1 : 1
光罩尺寸	5"/7"/9"
基板尺寸	4"/6"/8" wafer TSA/BSA 12/25/40/50 mm chip TSA

## 所在位置

奈米電子大樓  
無塵室100(黃光室)



實驗棟三樓平面圖

# 系統外觀



狀態指示燈  
Light tower

晶圓自動傳送裝置  
Cassette/PA/robot

載具收納盒  
Magazine

隔振基座  
Foundation

曝光源  
Light source

螢幕  
Monitor

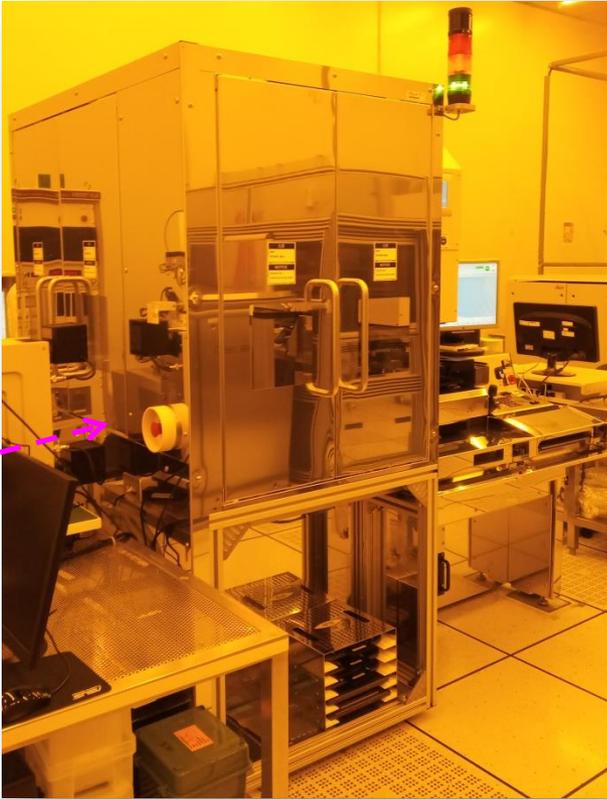
光罩載台  
Cover

操控台  
Control panel

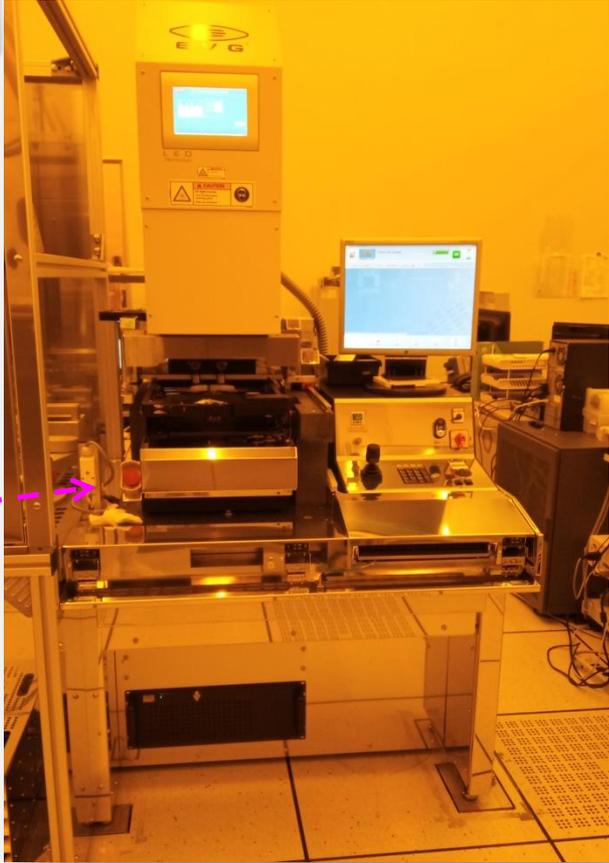
晶圓載台  
Wafer stage

# 緊急停機開關-EMO

!!!  
設備可能危害人員或實驗室時  
按下紅色按鈕



位於晶圓  
自動傳送  
裝置側面  
1處



位於晶圓  
載台側面  
1處

## 服務內容

- 晶圓曝光作業
- 光阻製程設備：
  - L09\_Track-自動化光阻塗佈及顯影系統(6" 晶圓光阻旋塗/顯影製程)
  - L17\_阻劑塗佈及顯影系統ACT8(8" 晶圓光阻旋塗/顯影製程)

***NARLabs***

---

**END**